

独自の成膜技術とトリートメント技術で、 高品質な半導体製造装置を開発・生産

1. BCD[®] (Balance Controlled Deposition) 技術による薄膜生成

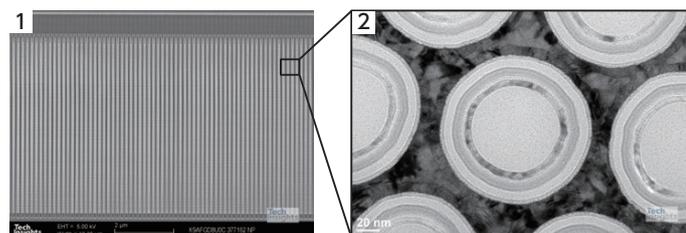
当社独自のBCD[®]技術により、高アスペクト比に対する優れた段差被覆性と組成比制御での高品質薄膜生成を可能としています。

※BCDは株式会社KOKUSAI ELECTRICの日本における登録商標です。

2. 新エネルギー源によるトリートメント

高アスペクト比に対応する酸化・膜質改善技術や、光・プラズマなどのさまざまなエネルギー活用による高付加価値トリートメント技術を採用しています。

3D NANDメモリーセル断面



Source: TechInsights (1,2)

主要製品

バッチプロセス装置



高生産性縦型装置
AdvancedAce[®]-300



高品質成膜・高性能半導体製造装置
TSURUGI-C² 剣[®]

200mmウェーハ対応
バッチサーマル
プロセス装置



枚葉プロセス装置



枚葉プラズマ窒化・酸化装置
MARORA[®]



枚葉キュア・アニール装置
TANDUO[®]

枚葉アッシング装置
Lambda300



※TSURUGI-C²、剣のロゴ、AdvancedAce、MARORA、TANDUOは株式会社KOKUSAI ELECTRICの登録商標です。

世界の半導体の発展に貢献
グローバルなネットワークの構築により

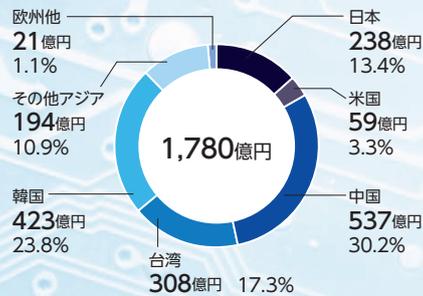
売上収益(連結)

1,780 億円

営業利益(連結)

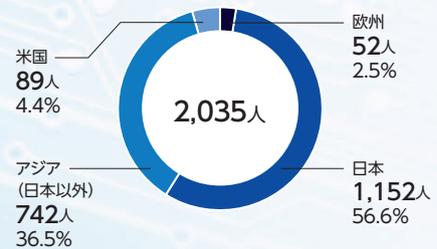
600 億円

地域ごとの売上収益(連結)



※上記は2021年3月期の数値です。
お客様の所在地をもとに計算しています。

地域ごとの人員割合(連結)



※2021年3月31日現在

主な開発、設計、生産拠点

富山事業所

立山連峰を望む富山市八尾町。専用のクリーンルーム内で次世代プロセスに対応した半導体製造装置等の開発、設計、生産を行い、世界の大手ユーザーからの最先端の高度な製品ニーズに対応しています。



株式会社国際電気セミコンダクターサービス 上市事業所

北アルプス剋岳の麓に位置し自然環境に恵まれた富山県上市町で、超音波洗浄機、抵抗率測定器の開発、設計、生産および半導体製造装置向けコントローラーの生産を行い、世界のユーザーへ製品を供給しています。



Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 天安本社・工場

韓国の首都ソウルから南に約100kmの距離にある忠清南道天安市に位置し、半導体製造装置の設計、生産、改造を行って韓国のユーザーを中心に製品を供給しています。



Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 平澤工場

韓国の首都ソウルの南に位置した京畿道平澤市。韓国ユーザーのサービス拠点として、また、半導体製造装置の評価開発を行い、地産地消を活かし、高度な技術と製品ニーズに対応しています。

